

日中韓特許庁長官会合について

2013年11月
特 許 庁

1. 趣旨

特許庁(JPO)、中国国家知識産権局(SIPO)、韓国特許庁(KIPO)は、知的財産の保護・強化、特許審査の迅速化・品質向上、制度調和の推進等を目的として、2001年から長官会合を毎年開催し、制度・審査実務の各国比較、IT化、人材育成等の幅広い協力関係を展開しているところであり、13回目の会合を11月14日に札幌で開催。

2. 結果(概要)

(1) 特許分野の協力

3国の知財制度・運用に係る比較研究を行い、これまでに、特許要件である「進歩性」「新規性」及び「実用新案制度」をテーマとして採り上げてきたところ。このたび、実務上重要な出願書類の「記載要件」*1について、法令・審査基準の比較研究を実施し*2、報告書を了承、公表。

これらの取組をはじめ、3庁の専門家による各庁の取組に関する情報交換等を通じて、特許審査の質の向上に向けた協力関係強化を合意。

*1「記載要件」:権利範囲を記載する書類(「特許請求の範囲」)や発明の内容を説明する書類(「明細書」)等の出願書類の記載に関する要件。例えば、権利を求める技術的な範囲が明確であること、第三者が発明を実施できる程度に記載されていること、等が3国においての要件とされている。一方、出願書類は公開されることから、模倣されるリスクも意識して、不必要に過度な情報を出願書類に記載しないことも、企業にとって実務上重要な課題に。

*2「記載要件」に関する比較研究:3庁で基本的な要件とその判断に係る考え方におおむね一致。しかしながら、例えば、中国では、化合物の発明について「特許請求の範囲」に医薬用途の記載がなくても、「明細書」に医薬用途が記載されていれば、出願時に医薬の効果を証明する薬理データを記載する必要がある(日韓では不要)など、細かい部分で差異あり。

(2) 意匠分野の協力

3庁が共同で意匠制度の相違点について比較研究を行う「日中韓デザインフォーラム」(2012年11月に東京で開催)について、各国意匠制度の相互理解に寄与するとともに各国ユーザーと意匠制度に関する意見交換を行う重要な機会であるという認識を共有し、今後とも継続することについて合意。

(3) 機械化分野の協力

3国の特許出願内容を公開した「公開公報」等の特許関連情報に対して各国企業が容易にアクセスし、技術開発の効率化、知財戦略等に活用できることが重要であるとの観点から、このための情報基盤を3庁共同で整備するべく取り組んできたところ。このための活動が開始から10年を迎えたことを踏まえ、これまでの協力内容を総括した「10年レポート」を公表。

あわせて、3庁の協力の成果をユーザーに広く周知することを目的として、日中韓特許庁の共同ウェブサイト「TRIPO」を立ち上げたところ。「TRIPO」においては、新規性・進歩性等の各国の知財制度の重要な相違点を取りまとめた3国共同の報告書や各国の法令・審査基準を見やすく整理した対比表等を提供。

(4) 審判分野の協力

本年8月に初めて開催した日中韓審判専門家会合の有益性を確認し、今後定期的に開催することによって、各国の審判制度や統計データについて情報交換を進めるとともに、各国の審判手続に関する相違点の研究を実施することで合意。

(5) 営業秘密の保護に関する協力

我が国の提案により、3庁で各国の取組に関する意見交換と専門家を交えた研究に着手することによって、効果的な保護のあり方に向けた協力を進めていくことで合意。



日中韓知財協力ウェブサイト「TRIPO」の開設について
(プレスリリース)
(仮訳)

日本国特許庁（JPO）、韓国特許庁（KIPO）、中国国家知識産権局（SIPO）（以下「3庁」）は、2013年11月14日の第13回日中韓特許庁長官会合において、公衆向けの日中韓知財協力ウェブサイト「TRIPO」の開設に合意しました。

3庁は、年々増え続ける特許出願とこれに伴うワークロードの増加等の共通の課題に対応するため、2001年から特許・意匠分野、情報技術分野、知財の人材育成分野等における多岐に亘る協力を進めてきました。TRIPOは、3庁間での協力事項や成果を、一般公衆の皆様にご活用いただくべく、情報発信することを目的としています。

TRIPOには、これまでの3庁の取組の紹介に加え、一般公衆の皆様にとって有益と思われる各種コンテンツ、例えば、各庁の新規性・進歩性判断の比較結果を纏めた事例研究報告書、各庁の法令・審査基準を見易く整理した対比表、各国の知財関連の法令や特許情報検索サービスに関するリンク集等の情報が掲載されています。

現在、日本、韓国及び中国への特許出願件数は、世界の特許出願の41%を占めるに至り、益々、3庁の役割の重要性が増しております。3庁は、今後とも一層、相互協力を推進し、一般公衆の皆様にも裨益する情報発信に努めて参ります。

TRIPO へのリンクはこちら
(<http://www.tripo.org/>)

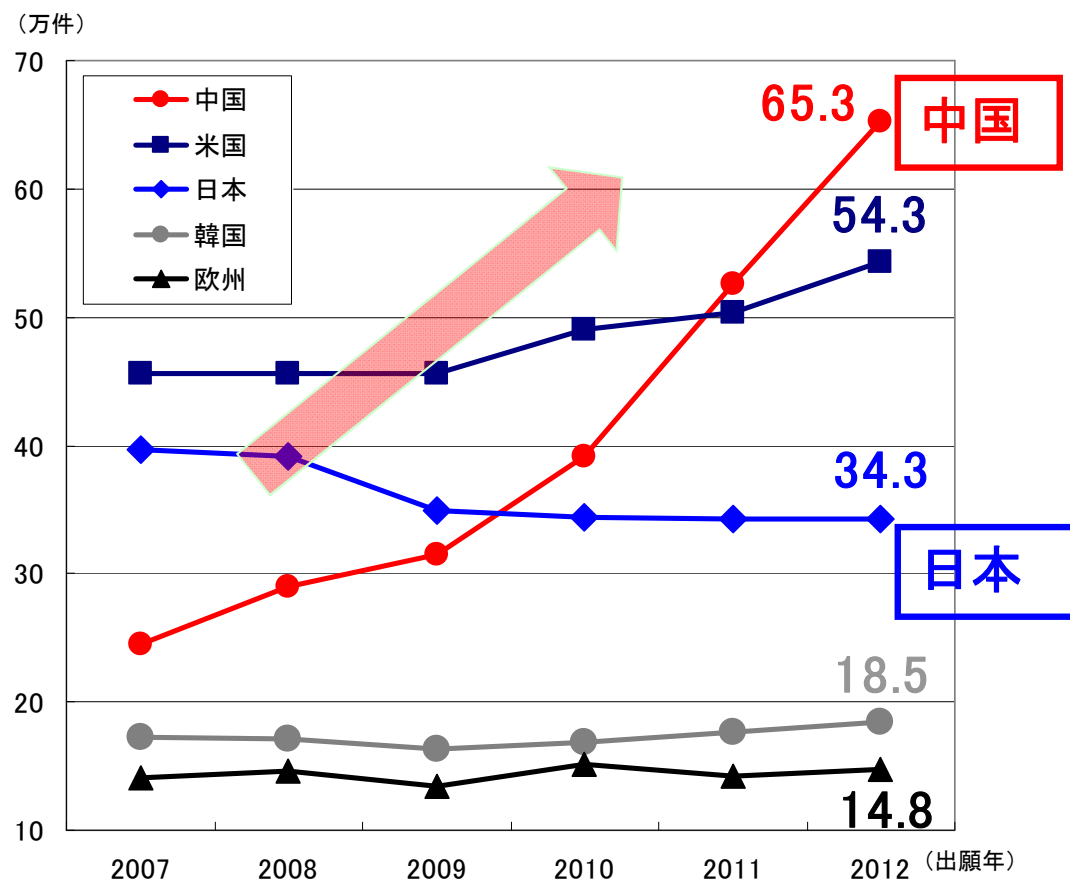
2013年11月14日

日中韓特許庁長官会合について (参考資料)

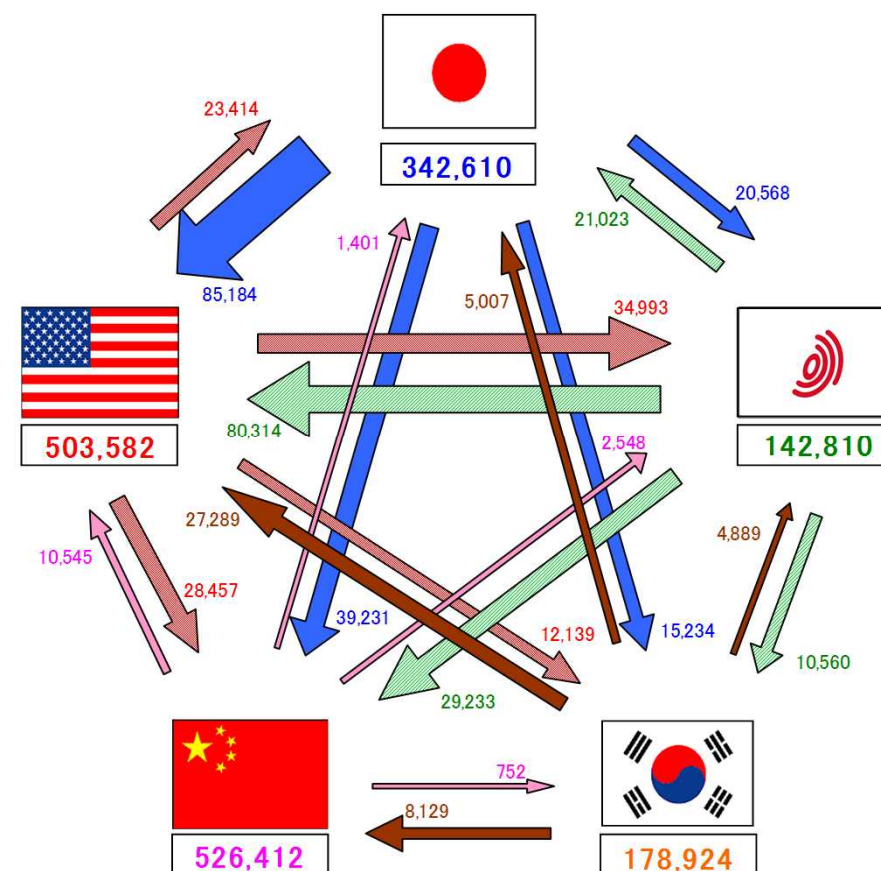
2013年11月28日
特 許 庁

- 中国は特許出願件数で日本及び米国を上回り、2011年に世界1位の出願大国に。2012年も65.3万件と、その地位を不動のものとしつつある。
- 日本の特許出願件数は2008年リーマンショック後に減少、その後下げ止まり傾向。

五大特許庁における特許出願件数の推移



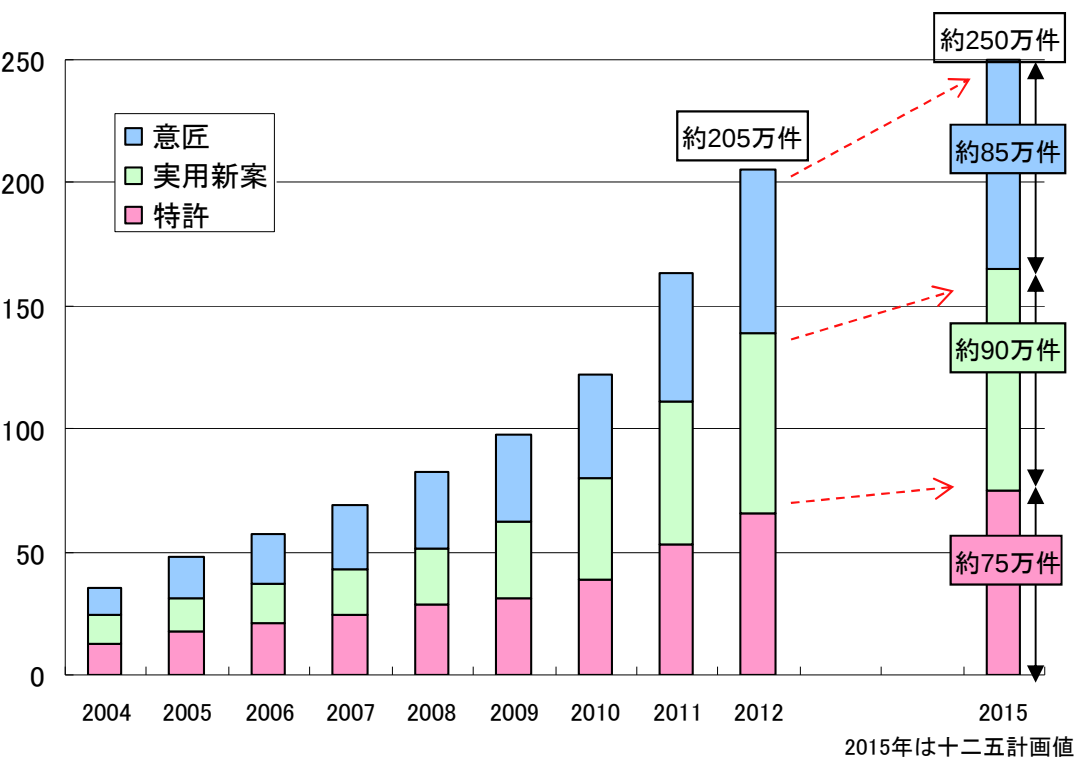
五大特許庁間の特許出願状況



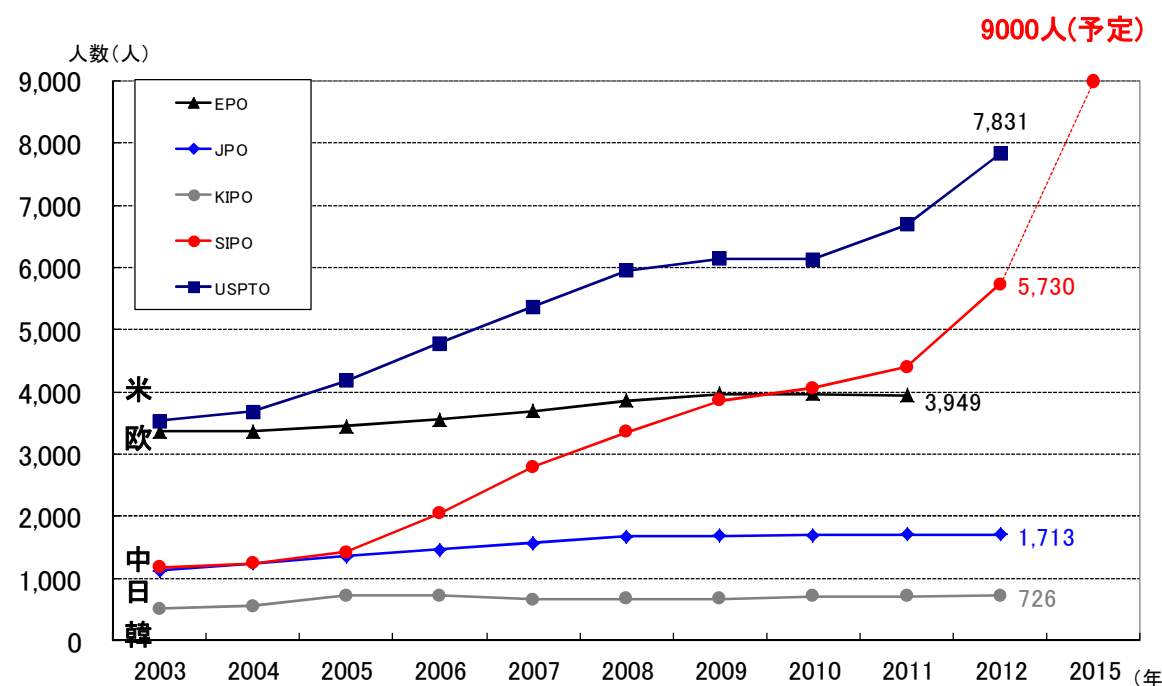
中国「特許出願大国化」～出願件数の急増と審査官の増員～

- 中国は特許審査官数を2015年までに9000人に増員予定。
- 2015年の特許・実用新案・意匠の出願件数についても、「十二五計画」において、それぞれ約75万件、約90万件、約85万件になると予測。
- 背景には、政策的な出願奨励策(報奨金や法人税減税)あり。

【特許・実用新案・意匠出願件数予測】



【日米欧中韓の審査官数の推移】



(資料) SIPO Annual Report, SIPO ウェブサイトより特許庁作成

(出典) 2013年版特許行政年次報告書

【特許権】

リチウムイオン電池に関する発明や、画面操作インターフェイス(ズーム・回転等)に関する発明、ゲームプログラムの発明など

新しい発明を保護
(出願から20年
(一部出願から25年))

商品やサービスに
使用するマークを保護
(登録から10年。更新あり)

【商標権】

電話機メーカーやキャリア各社が自社製品の信用保持のため製品や包装に表示するマーク

【実用新案権】

電話機の構造に関する考案、ボタンの配置や構造など

物品の構造・形状の考案を保護
(出願から10年)

【意匠権】

電話機をスマートにした形状や模様、色彩に関するデザインなど

物品のデザインを保護
(登録から20年)



- 特に、中国において近年出願が急増する実用新案については、無審査主義であることに加えて、技術評価書および情報提供制度に係る運用が不明確である、とのユーザーの指摘あり。
- 制度の運用も含めた日中韓の各国における実用新案制度の比較を通じて、各国制度の相互理解・改善を促進。

【日中韓実用新案制度比較表の概要】

	日本	中国	韓国
権利期間	出願から10年	出願から10年	出願から10年
実体審査の有無	方式審査＋基礎的要件 (実体審査なし)	方式審査＋基礎的要件 (実体審査なし)	方式審査＋実体審査
権利行使時の 技術評価書提示義務	技術評価書を提示して警告した 後でなければ権利行使不可	規定はないが、侵害訴訟時に裁 判所に提出しなければならない	審査主義のため 技術評価書なし
技術評価書の 請求人適格	何人も可	権利者もしくはライセンシー	
技術評価書の 請求可能回数	制限なし	1回のみ	
情報提供制度	何人も可	規定はないが、第三者からの情 報があれば、技術評価書作成 時に考慮する	何人も可
高度な注意義務規定※	あり	なし	なし

※日本の実用新案制度では、特許制度と異なり、相当の注意をせずに警告や権利行使を行った(例えば実用新案技術評価書において新規性がないとの評価を受けたにも関わらず警告や権利行使した場合など)後に、無効審判や審決取消訴訟で実用新案権が無効になった場合は、その警告や権利行使により相手方に与えた損害を賠償する責めを負う。これにより、権利の濫用を防止している。

【日中韓意匠制度の比較】

	日本	中国	韓国
存続期間	登録日から20年	出願日から10年	登録日から15年 (改正法施行(2014/7/1)後は20年)
部分意匠制度	有	無	有
秘密意匠・公開繰延	有 (登録から3年)	無	有 (登録から3年)
ハーグ協定のジュネーブ改正協定	加盟に向けた検討中	加盟に向けた検討中	法改正済

＜韓国特許庁「知識財産基盤の創造経済実現戦略」＞

中小企業の営業秘密漏えいを防止するため、公正取引委員会、中小企業庁、特許庁（営業秘密保護センター）、警察（産業技術流出捜査隊）等と連携、ワンストップサービスを構築

＜営業秘密保護センター＞

○設置時期 2012年

- 主要業務
- ・ 営業秘密原本証明サービス（本サービスは、2010年開始）
 - ・ 各機関と連携した営業秘密流出に関する相談対応
 - ・ 営業秘密標準管理システムの提供
 - ・ 営業秘密管理状況の無料診断
 - ・ 企業担当者等の教育、カンファレンス、教育コンテンツ作成

2013年11月時点での営業秘密原本登録数は、3万件以上。

大部分は、大企業による利用。日本企業からの問い合わせはあったものの、日本企業の利用実績はなし。



*基本料金1万ウォン/初年、維持料3千ウォン/年、オンライン申請により利用し、韓国法人名義の公認認証書が必要

*2012年9月現在の累計で129社、1万件以上の利用あり

TRIPO

[Home](#) [JEGA](#) [JEGPE](#) [Roadmap](#) [Laws&Regulations](#) [Statistics](#) [Public Service](#)



10-Year Development Report of JEGA

JEGA



The State Intellectual Property Office of the People's Republic of China, the Japan Patent Office and the Korean Intellectual Property Office agreed to establish the Joint.... [[More>>](#)]

[10-Year Development Report of JEGA](#)

JEGPE



Joint Expert Group for Patent Examination (JEGPE) project was established in 2009 in order to promote patent cooperation among JPO, KIPO and SIPO. The trilateral ... [[More>>](#)]

[Study Reports](#)



Roadmap



Internet Service Matrix



Laws&Regulations



Statistics



Public Service



Korean Intellectual
Property Office



Japan Patent Office



State Intellectual Property
Office of P.R.China